

令和3年1月25日

Photomask Japan 組織委員会  
委員長 渡邊 健夫

## 国際ホトマスクシンポジウム(Photomask Japan)へのご協力のお願い

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお慶び申し上げます。

さて、Photomask Japanはホトマスクジャパン(PMJ)とSPIE(The International Society for Optical Engineering)の主催、BACUS、EMLCの共催を得て、マスクに関する総合的かつ実用的な国際会議として組織されたものです。本会議は毎年4月に開催しており、2021年は4月20日から21日にオンラインでのデジタルフォーラムとして開催されます。

COVID-19の影響を大きく受けた全世界の日常がニューノーマルを模索する中、半導体デバイスの高性能化による5G通信、AI、IoT、車の自動運転などのあらゆる分野での高度情報化は着実に、そして加速して進んでいます。先端デバイスの微細化においてはEUVリソグラフィー(EUVL)の適用が開始されましたが、新たな半導体覇権争いの潮流が大きな関心を集め、我々半導体業界はその大きな流れの中にあります。また、非先端半導体デバイスの市場も拡大しており、半導体産業全体としては今後も新たなビジネススキームを展開しつつ、伸張していくものと思われまます。

EUVLはこの先の微細化を担う最もキーとなる製造技術であり、日本には欠かせない関連サプライヤーが数多く存在し、そのサプライチェーンを担っていますが、マスク関連においてはペリクルを始め、材料・加工プロセス・欠陥検査・修正技術など、未だ解決すべき課題も少なくありません。更には次期高NA化に向けた課題も挙げられています。また、光リソグラフィーと同様にマルチパターンニング、コンピューテーショナルリソグラフィーなどに対応したマスク関連技術開発も要求されています。ビッグデータを取り扱うデバイスの大容量化とコンピューテーショナルリソグラフィーの高度化要求(例えば曲線表現)により、マスク描画やデータの高速・高精度処理は益々重要な位置付けとなっています。

一方、製造技術の改革として低コストで微細化を実現するナノインプリントリソグラフィー(NIL)も、等倍マスク(テンプレート)が重要な要素技術であることは相違ありません。更には市場に応じて多様化するパターンニング技術にも幅広く応えていく必要があり、加工プロセスや計測技術などは半導体ウエハ製造との技術交流も不可欠となっています。

マスク技術開発では、製造装置、材料、プロセス、EDA等の広範囲な要素技術と事業戦略的な課題に加え、低コスト化に対する期待が非常に高いと言えます。これらの課題の解決と、高精度化・多機能化・多様化するマスクをタイムリーに低コストで提供していくためには、実用的な観点から関連分野の研究・技術情報を広く交換していくことが必要であり、本会議の性格として実用性を重視したいと考えています。

日本のマスク関連技術は世界をリードする立場にあり、国内でも半導体覇権についての戦略的対応と技術発信の重要性が問われる中、業界への貢献が期待されます。また、国内で国際会議をニューノーマルに沿った新しい形で開催することは国際間の技術交流、国際協調に寄与する上からも意義が大きいと考えられます。

つきましては、本会議開催の趣旨とその重要性をご賢察いただき、下記のように貴社のご援助、ご高配を賜りたくお願い申し上げます。

なお、Photomask Japan 2021に対しての寄付によるご援助と、Photomask Japan (2021年度)賛助会員としてのご援助の二通りの方法がございます。貴社のご都合にかなった方法でご協力いただければ幸いです。

会議の情報、Digest of Papers(予稿集)、会務の報告等は、賛助会員、寄付のいずれの場合につきましても送付させていただきます。よろしくご理解の程お願い申し上げます。

敬具

## 記

1. 賛助会入会の場合は、添付の「賛助会入会申込書」によりお願い申し上げます。

ご寄付いただく場合は、同封の「寄付申込書」によりお願い申し上げます。

2. 払込方法： 下記の口座にお振り込みください。

銀行名： 三菱UFJ銀行  
支店名： 新丸の内支店 (店番号 422)  
口座番号： (普) 4910525  
口座名： Photomask Japan  
口座名フリガナ： ホトマスクジャパン

3. 本件照会先、申込書送付先

ホトマスクジャパン事務局

〒105-8335

東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング

(株)JTBコミュニケーションデザイン内

FAX:03-3452-8550

E-mail:pmj@jtbcom.co.jp

4. お申込期限 2021年4月19日(月)

※2021年2月26日(金)までにお申込の場合は、「Digest of Papers」(予稿集)に社名を掲載いたします。

5. お振込期限 2021年4月19日(金)

以上

添付書類 (1) Photomask Japan 2021 開催趣意書  
(2) Photomask Japan 賛助会規程  
(3) Photomask Japan 賛助会入会申込書(2021年度)  
(4) Photomask Japan 2021 寄付申込書